综述

空间电子辐射环境中绝缘介质电荷沉积 特性及陷阱参数研究综述^{*}

李国倡1)2) 李盛涛2)†

(青岛科技大学先进电工材料研究院,青岛 266042)
 (西安交通大学,电力设备电气绝缘国家重点实验室,西安 710049)
 (2019 年 8 月 19 日收到; 2019 年 9 月 11 日收到修改稿)

空间电子辐射环境中绝缘介质充放电特性与介质表面电荷交换过程或内部电荷迁移过程密切相关.介质表面/内部电荷运动很大程度上取决于材料的微观特性,空间电荷与陷阱是反映绝缘介质微观特性的重要参数.本文综述了电子辐射环境中绝缘介质内部空间电荷和陷阱的形成、作用机理、测量方法、存在的问题及国内外研究现状.首先,简要介绍了入射电子与介质材料的相互作用机理及沉积电荷的形成;分析了电子束辐射下介质内部电荷迁移模型,辐射诱导电导模型(RIC模型)和电子-空穴对的产生/复合模型(GR模型)的优缺点;对比分析了经典电声脉冲法(PEA)以及适用于电子束辐射下空间电荷测量的"短路 PEA"和"开路 PEA",并总结了电子辐射下 PEA 装置设计中存在的主要技术难点;其次,简要介绍了电子束辐射下陷阱的形成及作用机理,分析了聚合物介质陷阱参数的提取方法,如热刺激电流法、表面电位衰减法(电晕注入方式或电子辐射方式)、空间电荷衰减法,指出在同一真空环境中完成电子注入和表面电位测量的方法较适合空间介质材料陷阱参数的表征,并以聚酰亚胺为例,进行了陷阱参数提取;最后,从理论模型、参数表征和测量技术等方面,展望了空间绝缘介质亟需解决的科学问题.

关键词:空间辐射环境,空间电荷特性,陷阱分布,电声脉冲法
 PACS: 94.05.Hk, 94.05.sj, 21.10.Ft. 77.84.-s
 DOI: 10.7498/aps.68.20191252

1 引 言

空间等离子体、高能粒子、原子氧等辐射环境 与航天器介质/器件相互作用会诱发多种航天器异 常现象^[1-4]. Koons 等^[5] 对航天器异常故障统计表 明,在 299 例故障中,由空间介质充放电引起的故 障占总故障的 54.2%. 根据入射电子能量和材料特 性的不同,电子在材料中的穿透深度不同. 当入射 电子能量较低时 (keV 级),电子会停留在接近介质 表面很浅的位置 (μm 级),形成表面充放电现象; 当入射电子能量较高时 (MeV 级), 高能电子会穿 透航天器屏蔽层及材料表面, 透入介质材料内部, 在介质内部沉积, 形成深层充放电现象^[4].

空间辐射电子与介质材料相互作用,无论是表 面充放电现象还是深层充放电现象,均涉及电荷的 运动过程,而电荷的运动特性与材料的陷阱分布有 关系.电子束辐射下,绝缘介质的陷阱能级和陷阱 密度会影响电荷注入、输运和消散过程,进而影响 空间电荷积聚特性,介质内部空间电荷的不断积聚 会导致局部电场集中,当局部畸变电场超过材料击 穿阈值时会发生体击穿;此外,介质内部空间电荷

* 国家自然科学基金 (批准号: 51907095, 11575140)、中国博士后科学基金 (批准号: 2019M653629) 和青岛市应用基础研究计划 (批准号: 18-2-2-23-jch) 资助的课题.

© 2019 中国物理学会 Chinese Physical Society

[†] 通信作者. E-mail: sli@mail.xjtu.edu.cn

的积聚还会导致表面电位的升高,对不同绝缘材料和结构,其表面电位不同,易导致介质不等量带电,从而引发沿面闪络或电弧放电^[1,2,4].

对于外施电压下聚合物介质材料空间电荷和 陷阱的作用机理、测量方法和数值仿真等方面的研 究较多^[6-11].以电声脉冲法 (PEA) 为代表的空间 电荷测量装置的成熟应用,极大地促进了电介质空 间电荷理论和材料空间电荷特性的发展.此外,热 刺激电流法、光刺激电流法、表面电位衰减法等测 量方法,已被广泛应用于介质材料陷阱参数的提 取^[12-14].在模型与数值仿真方面,发展了电荷跳跃 输运模型、陷阱动态捕获模型等用于描述聚合物介 质空间电荷积聚特性和陷阱入陷、脱陷的动态过 程^[10,11,15].

基于上述研究基础,国内外学者积极开展了空间辐射环境下材料微观特性的表征方法和测量技术研究.法国Laurent团队^[16-18]将经典PEA装置改进为适用于电子辐射环境测量要求的"短路PEA"和"开路PEA";并采用双极性电荷输运模型,分析空间电荷测量数据,拟合优化材料的微观参数.美国Dennison团队^[19-20]研究了电子束辐射下绝缘材料辐射诱导电导率测量方法和辐射充电后介质表面电位原位测量方法.在国内,中国科学院空间中心^[21-23]、航天五院^[24,25]、西安交通大学^[26-29]、军械工程学院^[30-33]等单位做了较多的实验和计算工作.我们课题组^[34,35]采用表面电位衰减法研究了电子束辐射后聚酰亚胺的陷阱特性;采用表面电位衰减理论和遗传算法,提取了材料表面/体电阻率和载流子迁移率等参数.

本文介绍了入射电子与介质材料的相互作用 机理及介质内部沉积电荷和陷阱的形成,总结了电 子束辐射下介质内部电荷迁移模型的优缺点;对比 分析了经典 PEA 以及适用于电子束辐射下空间电 荷测量的"短路 PEA"和"开路 PEA",并总结了电 子辐射下 PEA 装置设计中存在的主要技术难点; 对比分析了聚合物介质陷阱参数的提取方法;展望 了空间绝缘介质领域亟需解决的理论和实验问题.

2 电子束辐射下介质电荷沉积特性

2.1 电子束辐射下介质内部沉积电荷的 形成

当入射电子垂直入射到一定厚度的介质中时,

会与介质发生弹性碰撞和非弹性碰撞等物理过程, 逐渐将能量转移给材料,材料靶原子获得能量会发 生激发或电离过程^[1,26].入射电子能量的损失可以 用阻止本领描述,图1为入射电子与介质材料相互 作用及能量损失示意图.



图 1 人射电子与介质材料相互作用及能量损失示意图 (a) 入射电子与介质材料相互作用示意图; (b) 阻止能量与 穿透深度关系图

Fig. 1. Schematic diagram of interaction between incident electron and dielectric material and energy loss: (a) Interaction between incident electron and dielectric material; (b) diagram of stopping power and penetration depth.

按照统计分布可知,电子能量转移沿介质深度 方向呈现先增加后减小的趋势,峰值点出现在入射 路径的末端,如图 1(b)所示.在距离表面较近的位 置,材料中原子获得的能量较小,发生激发和电离 的概率较小;在一定深度处,当电子能量损失达到 最大时,动量转移和能量损失达到最大值,晶格中 原子位移的概率、材料中原子的发热、激发和电离 也达到最大.之后,电子能量逐渐衰减为零,逐渐 沉积在材料内部,按照统计分布规律,电子会随机 停留在某位置.此外,由于材料自身的暗电导和高 能电子辐射引起的辐射诱导电导的作用,介质内部 电荷泄漏过程会加快.通常,电子沉积速率远大于 电荷泄漏速率,导致介质内部危险电荷不断沉积.

根据图 1(b) 所示的曲线, 电子在材料中的射程为从介质表面到阻止能量峰值点与能量零点的

中点之间的距离^[1,2]. 入射电子在介质中的射程主要和入射电子能量和材料密度相关,可以通过Weber半经验公式计算^[26,27],表达式为

$$R = \frac{\alpha E_0}{\rho} \left(1 - \frac{\beta}{1 + \gamma E_0} \right), \tag{1}$$

其中, *R* 是电子在材料中的射程, 单位 cm; α , β , γ 分别为0.55 g/(cm²·MeV), 0.9841 MeV⁻¹, 3 MeV⁻¹; E_0 是电子初始能量, 单位 MeV; ρ 是介质的密度, 单位 g·cm⁻³.

材料内部电荷沉积可以通过电荷沉积公式计算,单位时间介质内部注入电荷表达式为^[26,27]

$$Q(x,t) = 14.42 \frac{x^3}{R^4} j_0 (1-\eta) \exp\left[-3.605 \left(\frac{x}{R}\right)^4\right],$$
(2)

其中, Q(x, t) 是单位时间注入电荷密度,单位 C/(m³·s); j_0 是入射电子束流密度,单位 A/m²; η 是背散射系数; x 是电子穿透深度,单位 cm.

计算中假定电子沿试样表面垂直入射,电子能 量为 0.3 MeV, 束流密度考虑恶劣电子环境为 2 × 10⁻⁸ μA/mm², 选取三种典型材料聚酰亚胺 (PI)、 聚四氟乙烯 (PTFE)、环氧树脂 (EP), 厚度为1 mm. 图 2 为典型绝缘介质内部电荷沉积速率分布.





Fig. 2. The charge deposition rate distributions in typical insulation dielectric.

不考虑介质内部电荷泄漏的情况下,介质内部 电荷沉积如图 2 所示.可以看出,介质内部沉积电 荷沿深度方向呈现先增加后降低的趋势,在一定深 度处达到最大值.将三种材料进行对比,PTFE内 部沉积电荷最多,在距离介质表面 0.26 mm 处,沉 积电荷速率为 8.86 × 10⁻⁵ C/(m³·s), EP 和 PI 内 部沉积电荷速率分别为 7.65 × 10⁻⁵ C/(m³·s) 和 5.88 × 10^{-5} C/(m³·s). 这是由于 PTFE 的密度约 为 2.20 g/cm³, 电子在材料内部运动过程中, 受到 的阻止能量较大, 多数电子沉积在距离介质表面较 近的位置.

2.2 电子束辐射下介质内部电荷迁移模型

基于外施电压下聚合物介质的电荷输运模型, 发展适用于电子辐射环境下的电荷迁移模型.比较 典型的模型包括:辐射诱导电导模型 (radiation induced conductivity, RIC模型)和电子-空穴对 的产生/复合模型 (generation and recombination, GR模型)^[4,26,27,36-40],模型示意图如图 3 所示.入 射电子进入介质内部,其能量会逐渐衰减并在一定 深度处停留;同时,在温度、电场等激励作用下,沉 积电荷会向接地电极泄漏.由于电子能量和材料特 性的不同,电子在材料内部的穿透深度不同,会在 其内部形成"辐射区"和"未辐射区".上述两个区域 的电荷传导机制有所不同,对于辐射区,由于辐射 作用会导致电荷传导过程明显加快,电荷到达未辐 射区后,传导过程减慢,主要由受温度和电场影响 的材料本征电导控制.



图 3 电子束辐射下介质内部电荷迁移模型示意图 (a) RIC 模型; (b) GR 模型

Fig. 3. Schematic diagram of charge transfer model under electron beam radiation: (a) RIC model; (b) GR model.

RIC模型从宏观上描述了电荷在介质内部的 迁移过程,即在高能电子辐射下,介质内部产生辐 射诱导电导,将该模型与用于描述材料本征电导的 "电荷跳跃模型"结合,可以用于研究电子辐射下材 料不同区域的电荷传导特性;GR模型从微观上考 虑电子-空穴对的产生/复合过程,较为精确地描述 了介质内部电荷迁移过程,但模型中包含一些不确 定的微观参数值,比如载流子对的产生率、复合率 等.目前,工程应用中多采用 RIC 模型或基于 RIC 的改进模型.因为电子辐射下,材料的辐射诱 导电导率比较容易测量,通过对不同剂量率下材料 电导率实验数据的拟合,易于得出公式中的未知参 数;此外,通过测量外施电压下材料的本征电导率, 可以拟合得出电荷跳跃电导模型中的相关参数.相 比而言,GR模型中电子和空穴对的产生率和复合 率不易通过实验数据确定.

2.3 电子束辐射下空间电荷的测量方法

随着电介质空间电荷理论的深入研究以及测 试技术的发展,空间电荷测量技术快速发展,相继 出现了多种非破坏性测量方法.根据测量原理的不 同,代表性测试方法包括热扩散法、压力波法和电 声脉冲法^[6,7].其中,电声脉冲法已广泛应用于外施 电压下聚合物材料、电缆结构等空间电荷特性的 研究.

空间辐射环境下介质表面/深层充放电过程与 介质表面/内部电子注入、迁移和积聚特性相关. 采用 PEA 法可以直观地观察介质内部电荷输运过 程,结合数学模型还可以进一步提取材料微观参 数、分析材料充放电特性.然而由于电子辐射环境 的复杂性,对 PEA 装置测试电极、传输线路、传感 器等均有特殊的设计和屏蔽要求.目前,国内尚没 有成熟的电子束辐射下空间电荷原位测量装置.通 常,空间辐射环境中,介质内部沉积电子会滞留长 达数天甚至数月,因此,可以考虑采用离线测量方 法,即先在模拟空间测试系统中对试品进行电子辐 射处理,再采用电声脉冲测试装置进行空间电荷 测试.

郑晓泉等[41,42]采用离线测量方法,研究了高

能电子辐射后 PTFE、三元乙丙橡胶 (EPDM)、聚 乙烯 (PE) 和 EP 等材料中的空间电荷特性.实验 中,首先采用高能电子 (1.2 MeV) 对上述试样辐射 一定时间 (10 min), 然后,将静置 1 h 后的试样, 在 PEA 系统中测量无直流电压下空间电荷分布. 实验结果发现,电子束辐射后试样内部,可以观察 到明显的负极性空间电荷积聚,相同辐射条件下, EPDM 中电荷积聚最多,存储电荷能量较强,注入 深度约为 190 μm,抗辐射能力较差;其余三种材料 存储电荷能力近似,但阻挡电荷穿透能力不同.我 们课题组采用离线测量方法,初步研究了电子辐射 处理之后 PI 的电荷分布.

为了对比电子辐射处理后离线电荷测量方法 的可靠性,实验中分别在模拟空间测试系统中采用 相同辐射条件对聚酰亚胺试样的上表面和下表面 分别进行辐射处理;然后,将其取出进行空间电荷 测试. 试样选用厚度 125 µm 的 Dupont 聚酰亚胺 材料,辐射条件设置为:电子能量 30 keV, 束流密 度 10 µA, 辐射时间 10 min. 电子辐射完成后, 将 试样取出,采用电声脉冲法测量试品空间电荷分 布,试样更换时间约为1h,电荷衰减时间为 30 min. 空间电荷测量中不施加直流电压, 仅采用 高压脉冲源使试样内部电荷产生扰动,测量沉积在 试样内部的电荷.对比图 4(a) 和图 4(b) 可知, 电 子辐射处理后,靠近试样的上表面和下表面位置存 在明显的沉积电荷. 分别进行上表面和下表面处理 的试样, 上表面附近电子数量为-2.65 C/m³, 下表 面附近电子数量为-4.10 C/m³. 随衰减时间延长, 30 s 至 1800 s, 材料内部电子衰减速率非常慢, 这



图 4 电子辐射处理后 PI 空间电荷衰减曲线 (a) 电子辐射处理试样上表面; (b) 电子辐射处理试样下表面 Fig. 4. Space charge decay curve of polyimide treated by electron radiation treatment: (a) The upper surface of the sample is treated; (b) the bottom surface of the sample is treated.

是由于聚酰亚胺材料的电阻率非常大,注入到材料 表层的电子较难经过试样内部达到地电极.根据 Weber 半经验公式^[26,27],能量 30 keV 的电子在 PI 内部的穿透深度约为 11.5 μm,大部分电子主要 沉积在材料的表面.

相比电子辐射处理后材料内部电荷离线测量 方法而言,电子辐射期间材料的空间电荷原位测量 方法更为直观,可以直接观察电子辐射期间材料内 部沉积电子分布,但空间电荷测试系统受电子辐射 环境的影响较大. 法国 Laurent 团队 [16-18] 较系统 地开展了电子束辐射下空间电荷原位测量、材料特 性分析及数值仿真等方面的工作. 将经典 PEA 装 置改进为适用于电子辐射环境测量要求的"短路 PEA"和"开路 PEA". 经典 PEA 中激励模块 (包 括:外施电压和高压脉冲)和探测模块通过上下电 极分别施加于试样两侧.改进后的整个系统,通过 金属板支撑,放置于真空腔体内,可以调节装置位 置,以满足实验中电子束垂直入射的要求.根据上 下电极处理方式的不同,可以分为"短路 PEA"和 "开路 PEA", 如图 5 所示 [4]. 第一种方法, 将激励 模块和探测模块置于试样下方,试样上表面通过离 子溅射仪涂覆极薄的金属电极 (~ 30 nm), 高压脉 冲通过金属电极施加于试样.辐射时,电子可以穿 透极薄的金属电极, 注入到介质内部. 该方法将试 样的上下表面均做接地处理,故称为"短路法";第 二种方法,将试样上表面做悬浮处理,不涂覆金属 电极,其表面电位会随着电子辐射条件的变化而变 化,称为浮动电位.设计可移动机构,在距离试样 上表面几微米的位置设置一金属电极,高压脉冲可 以通过该电极施加于试样.

与经典 PEA 相比,上述两种装置测量中,试 样与下电极无法通过机械压力使其充分接触,以利 于声信号的传输.因此,可以通过导电胶带保证试 样与下电极的良好接触.此外,对于经典 PEA,上 电极施加电压已知,可以由空间电荷分布计算出电 场分布;而上述两种方法,实验中,需要采用非接 触式表面电位计,将探头至于试样上方,测量辐射 后试样的表面电位分布.电子辐射下 PEA 装置设 计中,存在的主要技术难点有:1)为了满足厚试样 的测试需求,需要选择适合的高压脉冲源和 PVDF 传感器,同时对测试电极有特殊的设计要求; 2) 屏蔽设计,整个装置放置于高能电子辐射环境 下,对传输线路、激励模块和探测模块的屏蔽要求 较高,微小扰动经过放大,均会对测量结果产生较 大影响;3)系统校准,借助辅助测试手段或实验方 法有效校准测量装置.



图 5 电子束辐射下绝缘介质空间电荷原位测量装置示 意图 (a) 短路 PEA; (b) 开路 PEA

Fig. 5. Schematic diagram of space charge in situ measurement setup under electron beam radiation: (a) Short circuit PEA; (b) open circuit PEA.

3 电子束辐射下介质内部陷阱参数 分布

3.1 电子束辐射下介质内部陷阱形成

由于聚合物材料形态结构的复杂性,以及受生 产工艺,杂质粒子、老化、电子辐射等因素的影响, 其内部不可避免地存在物理或化学缺陷⁶⁰,导致晶 格的周期性被破坏,从而形成安德森局域态,局域 态会捕获自由移动电荷,因此,也称为电荷捕获中 心或陷阱中心⁶⁰.

高能量电子束辐射 (MeV级)下,聚合物介质 会发生微降解,分子链发生断链,从而在禁带中形 成大量局域态.一方面,高能电子碰撞材料靶原子, 可能使原子产生移位,出现晶格缺陷,导致介质内 部杂质能级升高;此外,激发和电离过程中容易导 致辐射诱导化学缺陷^[1,2],从而会在介质内部引入 较深能级的陷阱.聚合物介质内部陷阱中心捕获电 荷,会降低载流子有效迁移率;同时局部电荷的积 聚会导致电场畸变.电子束辐射下介质陷阱参数的 变化取决于电子能量、束流和时间等辐射条件,通 常 keV 级能量的电子辐射不会对材料带来大的破 坏,陷阱参数变化较小.

3.2 陷阱参数提取方法

按照介质表面或内部注入电荷方式及外部激励的不同,介质材料陷阱参数提取方法主要包括: 热刺激电流法、表面电位衰减法(电晕注入方式或 电子辐射方式)、空间电荷衰减法等^[9,10,43-47],从基 本原理、优缺点等方面对常用陷阱提取方法做了对 比,如表1所列.介质材料中陷阱参数提取的基本 原理为:通过电极/介质界面注入、针-板电晕注入 或电子辐射等方式向介质表面或内部注入电荷,电 荷在向介质内部迁移过程中,会被陷阱中心捕获, 成为陷阱电荷,对于能级较浅的陷阱电荷,能够在 较短时间内克服势垒,重新成为自由移动电荷;而 对于能级较深的陷阱电荷,只有在光、热、电场等 外部激励下,才能脱离陷阱中心.因此,测量中,电 荷注入过程完成后,通过施加外部激励,可以刺激 被捕获电荷,使其脱离陷阱中心.陷阱电荷脱陷过 程中引起的电流、表面电位、电荷变化,可以反映 介质内部陷阱特性的变化,进而结合数学模型,可 以计算出陷阱能级和陷阱密度.

表 1 绝缘介质陷阱参数提取方法对比

Table 1. Comparison of calculation methods of trap param	ieters.
--	---------

方法	基本原理	优缺点
等温表面电位衰减法 (ISPD)	采用电晕注入或电子辐射方式向介质表层注 入电荷,通过测量等温电位衰减曲线,提取陷 阱参数.	优点:可以区分电子陷阱和空穴陷阱 ^[30,45] ;电子辐射注入方 式更适合空间介质材料陷阱参数的测量 ^[28,34] . 缺点:电荷注入深度较浅(约1—2 μm),主要反映材料表面 或表层陷阱信息;不适用于较厚试样 ^[46] .
热刺激电流法(TSC)	采用热刺激或光刺激使介质内部被捕获电荷 脱陷,通过分析电流特征峰,提取陷阱参数.	优点:反映材料内部陷阱信息;可以区分陷阱能级 ^[39,47] . 缺点:无法区分陷阱类型.
电声脉冲法(PEA)	通过分析去压后总电荷量随时间的衰减规律, 提取陷阱参数.	优点:可以反映介质内部电荷动态过程 ^[9,10,47] . 缺点:无法区分陷阱类型;计算模型有待完善.

将上述方法应用于电子辐射后介质材料陷阱 参数的提取.郑晓泉等^[48]采用热刺激电流法测量 了低能电子束辐射(0—20 keV)后聚酰亚胺材料 的陷阱参数.结果表明,辐射后聚酰亚胺的陷阱能 级由辐射前的 0.61 eV 升高至 0.79 eV,总体陷阱 密度增大. Chen 等^[9,10]建立了基于双重陷阱能级 的电荷动态捕获模型,采用空间电荷衰减法,研究 了直流电压作用下低密度聚乙烯(LDPE)的陷阱 参数.测量不同加压时间下的空间电荷衰减曲线, 结合模型,拟合得出 LDPE 中两个陷阱能级分别 为 0.88 eV 和 1.01 eV.本课题组^[34]采用表面电位 衰减法研究了电子束辐射后聚酰亚胺的陷阱特性. 实验中,电子辐射停止后,保持真空环境不变,直 接在真空腔体内部采用非接触式表面电位计测量 聚酰亚胺表面的电位衰减.

综合上述方法,分析认为在相同真空环境下, 完成电子注入和表面电位测量的方法较为适合电 子束辐射后介质材料陷阱参数的测量.一方面,对 于热刺激电流法和空间电荷衰减法,电子辐射装置 和测量装置分别属于不同的测量系统,不能在相同 环境下完成电子辐射和陷阱测量.而操作过程中环 境温度、湿度、真空度的改变可能对陷阱特性产生 影响,因此,这两种方法不能全面的反映和提取材料的陷阱信息;另一方面,本身电子辐射处理,会向介质内部注入电荷,对于聚酰亚胺、聚四氟乙烯等高阻性绝缘材料,电荷在介质内部滞留时间较长.如果辐射完成后,再进行热刺激电流或空间电荷测量,通过施加电压的方式注入电荷,这部分电荷与试样内部由于辐射滞留的电荷发生复合或叠加,会影响测量结果;此外,热刺激电流法和空间电荷衰减法对试样厚度具有特殊要求.

3.3 电子束辐射下聚酰亚胺陷阱参数提取

在真空腔体内部安装了二维移动平台和非接 触式表面电位计,用于实现电子束辐射下材料表面 电位的测量,如图 6 所示.电子能量为 0.1—40 keV; 束流密度为 10 nA—500 μA.

实验中,由于非接触式表面电位计的最大量程 为10 kV,故电子能量不能过高,设置为3—11 keV. 发射电流为10 μA,聚酰亚胺厚度为50 μm.测量 了不同能量电子辐射下聚酰亚胺的表面电位衰减 曲线,并采用 Simmons 理论分析表面电位衰减数 据,计算得出不同能量电子辐射条件下聚酰亚胺的 表面陷阱分布谱图,如图 7 所示^[34].





Fig. 6. Surface potential measuring system of insulation under electron radiation.



图 7 不同能量电子辐射下 PI 陷阱能谱分布图^[34] Fig. 7. Trap energy spectrum distribution of PI under electron radiation with different energies^[34].

由图7可以看出,电子辐射后,聚酰亚胺表面 陷阱分布谱图存在两个峰值,分别对应陷阱电荷数 量最大的两个陷阱能级,为便于分析,将其分别定 义为相对较浅陷阱能级和相对较深陷阱能级.相同 能量电子辐射下,以 11 keV 为例,浅陷阱电荷数 量大于深陷阱的数量,两个能级峰值 0.85 eV 和 0.93 eV 对应的陷阱密度分别为: 3.44 × 10¹⁷ m⁻³·eV⁻¹ 和 2.74×10^{17} m⁻³·eV⁻¹. 浅陷阱电荷在较短时间内 会迅速脱陷,表现为介质表面电位衰减速率较快, 而深陷阱电荷则长时间滞留在介质表层,表现为介 质表面电位衰减缓慢,深陷阱电荷的数量决定了表 面电位趋于稳定时表面电位的大小,其能级则决定 了趋于稳定的衰减时间.不同能量电子辐射下聚酰 亚胺的表面陷阱分布表现为不同的特性. 随着电子 能量的增加,浅陷阱能级轻微增大,从 0.81 eV 增 加至 0.85 eV. 深陷阱能级则基本保持不变. 此外, 随着电子能量增大,陷阱电荷密度明显增加,对比 3 keV 和 11 keV, 浅陷阱电荷密度从 7.69 × 10¹⁶ m⁻³·eV⁻¹ 增加至 3.44 × 10¹⁷ m⁻³·eV⁻¹, 深陷阱

电荷密度则从 $1.47 \times 10^{16} \text{ m}^{-3} \cdot \text{eV}^{-1}$ 增加至 $2.74 \times 10^{17} \text{ m}^{-3} \cdot \text{eV}^{-1}$.

由于实验条件限制,本文实验中电子能量选 取 3—11 keV,属于低能电子.由聚酰亚胺陷阱能 谱分布可以看出,低能电子辐射下,对于不同能量 (3—11 keV)的电子,表面陷阱能级和陷阱电荷密 度的变化范围并不大,因此,选择合适的辐射条件, 可以将电子辐射处理作为一种电荷注入方式,通过 测量表面电位衰减曲线,进而提取材料固有陷阱参 数.该方法与电晕注入电荷法相比,其优点是注入 电荷的类型、能量和数量可以控制,通过简单计算 可以得出介质表面/表层沉积电荷分布,便于更精 确地计算陷阱参数;此外,该方法表面电位的测量 在真空环境下进行,可以避免电晕实验中环境温 度、湿度等外界因素带来的干扰,测量得到的表面 电位原始数据更为准确.

4 结论与展望

相比普通环境下绝缘介质的特性而言, 空间辐 射环境中材料内部微观结构及宏观性能变化更为 复杂, 绝缘介质内部电荷迁移机制、放电特性和影 响因素亦有所不同.本文围绕"绝缘介质内部沉积 电荷和陷阱参数", 从微观过程、作用机理、表征方 法和测量技术等方面做了总结, 分析了机理模型和 表征测量中的重点和技术难点问题. 主要结论和展 望如下:

1) RIC 模型从宏观上描述了电荷在介质内部 的迁移过程,易于通过拟合实验数据得到未知参数; GR 模型则从微观上考虑了电子-空穴对的产生/复 合过程,较为精确,但模型中包含一些不易确定的 微观参数值,不利于工程问题分析,需要进一步发 展、完善电子束辐射下介质内部电荷迁移模型;

2)受电子辐射环境影响,材料内部微观参数 不易直接测量,尤其是高能电子辐射下微观参数的 原位测量较难实现;采用表面电位、泄漏电流等易 于测量的参数,结合反演数学模型,提取材料载流 子迁移率、陷阱能级、密度等微观参数是较好的研 究思路;

3) 电声脉冲法 (PEA) 可以直观地反映介质内 部空间电荷分布, 然而电子辐射环境对空间电荷测 试系统影响较大, 尤其是 MeV 级高能量电子辐射 下介质空间电荷原位测量较难实现, 需要重点解决 真空、辐射环境中 PEA 装置测试电极、传输线路、 传感器等各部分的屏蔽设计及系统工作稳定性.

参考文献

- Lai S T 2011 Fundamentals of Spacecraft Charging (New Jersey: Princeton University Press) pp156–167
- [2] Lai S T (translated by Li S T, Zheng X Q, Chen Y, Min D M) 2015 Fundamentals of Spacecraft Charging (Beijing: Science Press) pp135–141 (in Chinese) [黎树添 著 (李盛涛, 郑晓泉, 陈玉, 闵道敏 译) 2015 航天器带电原理 (北京: 科学出版 社) 第 135—141页]
- [3] Gupta S B, Kalaria K R, Vaghela N P 2014 IEEE Trans. Plasma Sci. 42 1072
- [4] Li S T, Li G C 2017 Chin. Sci. Bull. 62 990 (in Chinese) [李 盛涛, 李国倡 2017 科学通报 62 990]
- [5] Koons H C, Mazur J E, Selesnick R S, Blake J B, Frnnell J F, Rober J L, Anderson P C 2000 6th Spacecraft Charging Technology Conference Massachusetts, United States, Sep. 1–4, 2000 p7
- [6] Zhou Y X, Wang N H, Wang Y S, Sun Q, Liang X D, Guan Z C 2008 Transactions of China Electrotechnical Society 23 16 (in Chinese) [周远翔, 王宁华, 王云杉, 孙清, 梁曦东, 关志成 2008 电工技术学报 23 16]
- [7] Xin X L, Wu G N, Xu H H, Luo Y, Cao K J 2011 Insulating Materials 44 59 (in Chinese) [辛正亮, 吴广宁, 徐慧慧, 罗杨, 曹开江 2011 绝缘材料 44 59]
- [8] Li G C, Li S T, Min D M, Zhu Y W 2013 Sci. China 43 375 (in Chinese) [李国倡, 李盛涛, 闵道敏, 朱远惟 2013 中国科学 43 375]
- [9] Liao R J, Zhou T C, Chen G, Yang L J 2012 Acta Phys. Sin.
 61 017201 (in Chinese) [廖瑞金,周天春, Chen G,杨丽君 2012 物理学报 61 017201]
- [10] Zhou T C, Chen G, Liao R J, Xu Z Q, 2009 J. Appl. Phys. 110 043724
- [11] Laurent C, Teyssedre G, Le R S, Baudoin F 2013 IEEE Trans. Dielectr. Insul. 20 357
- [12] Yang B T, Tu D M, Liu Y N 1992 J. Appl. Phys. 10 233 (in Chinese) [杨百屯, 屠德民, 刘耀南 1992 应用科学学报 10 233]
- [13] Haque N, Dalai S, Chatterjee B, Chakravorti S 2017 IEEE Trans. Electr. Insul. 24 1896
- [14] Din D M, Mengu C, Arifur R K, Li S T 2012 IEEE Trans. Dielectr. Electr. Insul. 19 600
- [15] Severine L R, Teyssedre G, Laurent C, Segur P 2006 J. Phys. D: Appl. Phys. 39 298
- [16] Perrin C, Griseri V, Laurent C, Fukunaga K, Maeno T, Levy L, Payan D, Schwander D 2008 *High Performance Polymers* 20 535
- [17] Perrin C, Griseri V, Laurent C, Fukunaga K 2008 IEEE Trans. Dielectr. Electr. Insul. 15 958
- [18] Griseri V, Fukunaga K, Maeno T, Laurent C, Levy L 2004 IEEE Trans. Dielectr. Electr. Insul. 11 891
- [19] Hodges J L, Dennison J R, Dekany J, Wilson G, Evans A, Sim A 2014 IEEE Trans. Plasma Sci. 42 255
- [20] Dennison J R, Brunson J, Swaminathan P, Green N W, Frederickson A R 2006 IEEE Trans. Plasma Sci. 34 2191
- [21] Huang J G, Chen D 2004 Chin. J. Geophys. 47 392 (in Chinese) [黄建国, 陈东 2004 地球物理学报 47 392]
- [22] Huang J G, Chen D 2004 Acta Phys. Sin. 53 961 (in Chinese)

[黄建国, 陈东 2004 物理学报 53 961]

- [23] Quan R H, Han J W, Zhang Z L 2013 Acta Phys. Sin. 64 245205 (in Chinese) [全荣辉, 韩建伟, 张振龙 2013 物理学报 64 245205]
- [24] Qin X G, He D Y, Wang J 2009 Acta Phys. Sin. 58 684 (in Chinese) [秦晓刚, 贺德衍, 王骥 2009 物理学报 58 684]
- [25] Chen Y F, Yang S S, Qin X G, Liu Q, Shi L, Kong F L, Tang D T, Li C H 2010 Vacuum and Cryogenics 16 167 (in Chinese) [陈益峰, 杨生胜, 秦晓刚, 柳青, 史亮, 孔风连, 汤道坦, 李存惠 2010 真空与低温 16 167]
- [26] Li S T, Li G C, Min D M, Zhao N 2013 Acta Phys. Sin. 62 059401 (in Chinese) [李盛涛, 李国倡, 闵道敏, 赵妮 2013 物理
 学报 62 059401]
- [27] Li G C, Min D M, Li S T, Zheng X Q, Ru J S 2014 Acta Phys. Sin. 63 209401 (in Chinese) [李国倡, 闵道敏, 李盛涛, 郑 晓泉, 茹佳胜 2014 物理学报 63 209401]
- [28] Li G C 2017 Ph. D. Dissertation (Xi'an: Xi'an Jiaotong University) (in Chinese) [李国倡 2017 博士学位论文 (西安: 西 安交通大学)]
- [29] Li W Q, Hao J, Zhang H B 2015 Acta Phys. Sin. 64 086801
 (in Chinese) [李维勤, 郝杰, 张海波 2015 物理学报 64 086801]
- [30] Yi Z, Wang S, Tang X J, Wu Z C, Zhang C 2015 Acta Phys. Sin. 64 125201 (in Chinese) [易忠, 王松, 唐小金, 武占成, 张超 2015 物理学报 64 125201]
- [31] Cao H F, Liu S H, Sun Y W, Yuan Q Y 2013 Acta Phys. Sin.
 62 149402 (in Chinese) [曹鹤飞, 刘尚合, 孙永卫, 原青云 2013 物理学报 62 149402]
- [32] Cao H F, Liu S F, Sun Y W, Yuan Q Y 2013 Acta Phys. Sin.
 62 149401 (in Chinese) [曹鹤飞, 刘尚合, 孙永卫, 原青云 2013 物理学报 62 149401]
- [33] Fan Y J, Sun X J, Sun Y W, Zhou L D 2018 High Power Laser and Particle Beams. 30 114002 (in Chinese) [范亚杰,张 希军,孙永卫,周立栋 2018 强激光与粒子束 30 114002]
- [34] Li G C, Li S T, Pan S M, Min D M 2016 IEEE Trans. Dielectr. Electr. Insul. 23 2393
- [35] Min D M, Cho M, Li S T 2012 IEEE Trans. Dielectr. Electr. Insul. 19 2206
- [36] Baudoin F, Le Roy S, Teyssedre G 2008 J. Phys. D: Appl. Phys. 41 025306
- [37] Le Roy S, Baudoin F, Griseri V, Laurent C, Teyssedre G 2010 J. Phys. D: Appl. Phys. 43 315402
- [38] Le Roy S, Baudoin F, Griseri V 2012 J. Appl. Phys. 112 023704
- [39] Teyssedre G, Laurent C 2005 IEEE Trans. Dielectr. Electr. Insul. 12 857
- [40] Boufayed F, Teyssèdre G, Laurent C 2006 J. Appl. Phys. 100 104105
- [41] Liu X D, Zheng X Q, Zhang Y Q, Yang S S, Qin X G, Wang L 2007 *Electrical and Electrical Technology* 26 55 (in Chinese) [刘晓东, 郑晓泉, 张要强, 杨生胜, 秦晓刚, 王立 2007 电工电能新技术 26 55]
- [42] Ma L C, Zheng X Q, Liu X D, Zhang Y Q, Ma L C 2007 Proc. CSEE 27 32 (in Chinese) [马丽婵, 郑晓泉, 刘晓东, 张要 强 2007 中国电机工程学报 27 32]
- [43] Li G C, Li S T, Pan S M 2016 IEEE Trans. Dielectr. Electr. Insul. 23 1846
- [44] Gao Y, Wang X F, Li N, Xu B B, Wang J L, Du B X 2019
 High Voltage 45 2219 (in Chinese) [高宇, 王小芳, 李楠, 许棒
 棒, 王继隆, 杜伯学 2019 高电压技术 45 2219]
- [45] Shen W W, Mu H B, Zhang G J 2013 J. Appl. Phys. 113 083706

- [46] Simmons J G, Tam M C 1973 Phys. Rev. B 7 3706
- [47] Wei Y H, Chen G, Zhang G J, Liu N, Li G C 2016 AIP Adv.
 6 075120

REVIEW

[48] Zhang Z J, Miao J, Wang X Q, Wu W B, Yang P, Zheng X Q 2014 High Voltage Engineering 40 117 (in Chinese) [张振军, 苗军, 王学强, 吴文斌, 杨沛, 郑晓泉 2014 高电压技术 40 117]

Review of charge deposition characteristics and trap parameters of dielectric in space electron radiation environment^{*}

Li Guo-Chang¹⁾²⁾ Li Sheng-Tao^{2)†}

1) (Institute of Advanced Electrical Materials, Qingdao University of Science and Technology, Qingdao 266042, China)

 2) (State Key Laboratory of Electrical Insulation and Power Equipment, Xi'an Jiaotong University, Xi'an 710049, China) (Received 19 August 2019; revised manuscript received 11 September 2019)

Abstract

Charging and discharging characteristics of dielectric in space electron radiation environment are closely related to the surface charge exchange process and internal charge transfer process. Surface or internal charge movement of dielectric depends largely on the microscopic characteristics of the material, and space charge and trap are important parameters reflecting the microscopic characteristics of dielectric. In this work, the formation, mechanism, measurement method, existing problems and research status of space charge and trap in insulation material in electronic radiation environment are reviewed. Firstly, the interaction mechanism between incident electron and dielectric material and the formation of deposition charge are briefly introduced. The advantages and disadvantages of radiation-induced conductance model and electron-hole pair generation/recombination model are analyzed. The classical electro-acoustic pulse method (PEA) and "short circuit PEA" and "open circuit PEA" which are suitable for space charge measurement under electron beam radiation are compared with each other and analyzed, and further, the main technical difficulties in designing PEA device under electron beam radiation are reviewed. Secondly, the methods of extracting trap parameters, including thermal stimulation current method, surface potential decay method, space charge decay method are compared with each other.

It is pointed out that the method of injecting the electrons and the method of measuring the surface potential in the same vacuum environment are more suitable for measuring the trap parameters of space dielectric materials. Finally, the scientific problems that need solving in space insulation are prospected from the aspects of theoretical model, parameter characterization and measurement technology.

Keywords: space radiation environment, space charge characteristics, trap distribution, electro-acoustic pulse method

PACS: 94.05.Hk, 94.05.sj, 21.10.Ft. 77.84.-s

DOI: 10.7498/aps.68.20191252

^{*} Project supported by National Natural Science Foundation of China (Grant Nos. 51907095, 11575140), the China Postdoctoral Science Foundation (Grant No. 2019M653629), and the Qingdao Applied Foundation Basic Research Program, China (Grant No. 18-2-2-23-jch).

[†] Corresponding author. E-mail: sli@mail.xjtu.edu.cn